

عنوان مقاله:

مقایسه ی رشد ترجیحی فیلمهای اکسید روی با دو روش تبخیر با پرتو الکترونی و کند و پاش با بسامد رادیویی

محل انتشار:

کنفرانس فیزیک ایران 1388 (سال: 1388)

تعداد صفحات اصل مقاله: 4

نویسندگان:

الهه طلایی پاشیری - گروه فیزیک دانشگاه اصفهان

سید محمد حسن فیض - گروه فیزیک دانشگاه اصفهان

مرتضی مظفری - گروه فیزیک دانشگاه اصفهان

حمید رضا فلاح - آزمایشگاه تحقیقاتی لایه نشانی، دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:

فیلم های نازک ZnO بر روی بسترهای شیشه ای با دو روش تبخیر با پرتو الکترونی و کند و پاش با بسامد رادیویی رشد داده شدند. اثر بازپخت هم در خلأ و هم در هوا بر رشد ترجیحی فیلم های تهیه شده به روش اول بررسی شدند. برای بررسی جهت رشد فیلم ها، الگوی پراش پرتو ایکس همه ی نمونه ها تهیه شدند. این الگوها نشان میدهند که میتوان با روش کند و پاش بدون بازپخت، فیلم های اکسید روی با جهت گیری ترجیحی (002) تهیه کرد. رشد در این جهت، یکی از شرط های لازم برای بروز اثر پیزوالکتریک در این فیلم هاست که کاربردهای بسیاری دارند.

کلمات کلیدی:

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/85776>

